ETHYLENE TRIMERIZATION CATALYST AND TRIMERIZATION OF ETHYLENE IN THE PRESENCE OF THE SAME

Publication number: JP2000212212
Publication date: 2000-08-02

Inventor: OGURI MOTOHIRO; MIMURA HIDEYUKI; OKADA

HISANORI

Applicant: TOSOH CORP

Classification:

- international: C08F4/69; C07C2/32; C08F4/00; C07C2/00; (IPC1-7):

C08F4/69; C08F110/02

- European: C07C2/32

Application number: JP19990011492 19990120 Priority number(s): JP19990011492 19990120

Report a data error here

Abstract of JP2000212212

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain an ethylene trimerization catalyst used to produce 1-hexene from ethylene in high selectivity at good efficiency by using at least three components of a chromium complex coordinated with neutral polydentate ligands, an alkyl metal compound, and a modified clay mineral. SOLUTION: The chromium complex used is desirably a complex represented by the formula: ACrBn (wherein A is a neutral polydentate ligand; (n) is 1-3; and B is desirably a carbonyl, a 1-10C hydrocarbon group, a halogen, an amino, or a thioalkoxide. The neutral polydentate ligand is desirably the one having a tripod structure. The modified clay compound is desirably the reaction product of a clay mineral with at least one salt selected from among a protonate of an amine compound, a protonate of a phosphine compound, a phosphonium salt, an oxonium salt, a sulfonium salt, a carbonium salt, and a ferrocenium salt.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19)日本**国特許**庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-212212 (P2000-212212A)

(43)公開日 平成12年8月2日(2000.8.2)

(51) Int.Cl.?

識別配号

FΙ

テーマコート^{*}(参考)

C08F 4/69

110/02

C08F 4/69

4 1 0 2 8

110/02

審査請求 未請求 請求項の数7 〇L (全 15 頁)

(21)出顧番号

特願平11-11492

(71)出題人 000003300

東ソー株式会社

(22)出顧日

平成11年1月20日(1999.1.20)

山口県新南陽市開成町4560番地

(72)発明者 小栗 元宏

三重県四日市市別名6丁目7-8

(72)発明者 三村 英之

三重県四日市市別名3 丁目5-1

(72)発明者 岡田 久斯

三重県四日市市垂坂町366-1

最終頁に続く

(54)【発明の名称】 エチレンの三量化触媒及びそれを用いたエチレンの三量化方法

(57)【要約】

【課題】 エチレンから効率よく、かつ高選択的に1-ヘキセンを製造する。

【解決手段】 中性の多座配位子が配位したクロム錯体、アルキル金属化合物及び変性粘土化合物の少なくとも3成分からなる触媒を用いる。

【特許請求の範囲】

【請求項1】中性の多座配位子が配位したクロム錯体、 アルキル金属化合物及び変性粘土化合物の少なくとも3 成分からなるエチレンの三量化触媒。

【請求項2】変性粘土化合物が、粘土化合物とアミン化合物のプロトン酸塩及びホスフィン化合物のプロトン酸塩、ホスホニウム塩、オキソニウム塩、スルホニウム塩、カルボニウム塩、銀塩もしくはフェロセニウム塩からなる群より選ばれる1種以上の塩との反応生成物であることを特徴とする請求項1に記載のエチレンの三量化触媒。

【請求項3】中性の多座配位子が配位したクロム錯体が、下記一般式(1)

 $ACrB_n$ (1)

(式中、Aは中性の多座配位子である。nは1~3の整数であり、Bは水素原子、炭素数1~10の炭化水素基、カルボキシレート基もしくはジケトナート基、ハロゲン原子、アミド、イミド、アルコキシド、チオアルコキシド、カルボニル、アレーン、アルケン、アルキン、アミン、イミン、ニトリル、イソニトリル、ホスフィン、ホスフィンオキシド、ホスファイト、エーテル、スルホン、スルホキシド及びスルフィドからなる群より選ばれる1種以上を表す)で示される錯体であることを特徴とする請求項1又は請求項2に記載のエチレンの三量化的媒

【請求項4】中性の多座配位子が三脚型構造を有することを特徴とする請求項1乃至請求項3に記載のエチレンの三量化触媒。

【請求項5】中性の多座配位子がfacialに配位したクロム錯体を用いることを特徴とする請求項1乃至請求項4に記載のエチレンの三量化触媒。

【請求項6】アルキル金属化合物が、下記一般式(2) R_oMX_o (2)

(式中、pは0 < p ≤ 3であり、qは0 ≤ q < 3であって、しかもp+qは1~3である。Mはリチウム、マグネシウム、亜鉛、ボロン又はアルミニウムを表し、Rは炭素数1~10のアルキル基からなる群より選ばれる1種以上を表し、Xは水素原子、アルコキシ基、アリール基及びハロゲン原子からなる群より選ばれる1種以上を表す)で示される化合物であることを特徴とする請求項1乃至請求項5に記載のエチレンの三量化触媒。

【請求項7】請求項1乃至請求項6のいずれかに記載の エチレンの三量化触媒の存在下で、エチレンを三量化す ることを特徴とするエチレンの三量化方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、エチレンの三量化 触媒及びそれを用いたエチレンの三量化方法に関する。 さらに詳しくは、線状低密度ポリエチレン(LLDP E)の原料コモノマーとして有用な1-ヘキセンをエチ レンから効率よく、かつ高選択的に製造するエチレンの 三量化触媒及びそれを用いたエチレンの三量化方法に関 する。

[0002]

【従来の技術】エチレンを三量化して1-ヘキセンを得る方法において、特定の多座配位子が配位したクロム錯体とアルキルアルミニウム化合物からなる触媒を用いることは公知である。例えば、特開平10-7712号公報には、特定の窒素配位子が配位したクロムの塩素錯体やアルキル錯体とアルミニウム化合物からなる触媒が、特開平10-231317号公報には、環状ボリアミン又はヒドロトリス(ピラゾリル)ボレートが配位したクロム錯体とアルキルアルミニウム化合物からなる触媒が開示されている。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】しかし、特開平10-7712号公報に記載の方法は、触媒活性が低いという問題があった。また、オリゴマー中の1-ヘキセン選択性も低く、工業的な観点から十分なものではなかった。また、特開平10-231317号公報に記載の方法も触媒活性は低いものであった。さらに、選択性に関しても1-ヘキセンよりもポリエチレンの生成が多いばかりか、オリゴマー中の1-ヘキセン選択性も低いという欠点があった。

【0004】本発明は上記の課題に鑑みてなされたものであり、その目的は、LLDPEの原料コモノマーとして有用な1-ヘキセンをエチレンから効率よく、かつ高選択的に製造することができるエチレンの三量化触媒及びそれを用いたエチレンの三量化方法を提供することである。

[0005]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、上記の課題を解決するため鋭意検討を行った結果、中性の多座配位子が配位したクロム錯体、アルキル金属化合物及び変性粘土化合物の少なくとも3成分からなるエチレンの三量化験媒を用いると高い活性でエチレンの三量化反応が進行し、高選択的に1ーヘキセンが生成することを見い出し、本発明を完成するに至った。

【0006】即ち本発明は、中性の多座配位子が配位したクロム錯体、アルキル金属化合物及び変性粘土化合物の少なくとも3成分からなるエチレンの三量化触媒とそれを用いたエチレンの三量化方法に関する。

[0007]

【発明の実施の形態】次に、本発明についてさらに詳し く説明する。

【0008】本発明においては、エチレンの三量化触媒を構成する一成分として、変性粘土化合物が用いられる。変性粘土化合物は、粘土化合物とアミン化合物のプロトン酸塩及びホスフィン化合物のプロトン酸塩、ホスホニウム塩、オキソニウム塩、スルホニウム塩、カルボ

ニウム塩、銀塩もしくはフェロセニウム塩からなる群より選ばれる1種以上の塩との反応生成物が好適なものとして挙げられる。

【0009】ここで粘土化合物とは、一般にケイ素イオ ンに酸素イオンが配位してできる四面体とアルミニウ ム、マグネシウム又は鉄等のイオンに酸素又は水酸化物 のイオンが配位してできる八面体とから構成される無機 高分子化合物である。多くの粘土化合物の骨格構造は電 気的に中性ではなく、表面に正义は負の電荷を帯びてい る。この負電荷を補償するために層間にカチオンを有す るが、この層間カチオンは他のカチオンとイオン交換が 可能である。このため、層間カチオンの量はカチオン交 換容量(CEC)と呼ばれ、粘土100gあたりのミリ 当量数 (meq)によって表される。CECは粘土によ って異なるが、粘土ハンドブック第二版(日本粘土学会 編、技報堂出版株式会社発行)によれば、カオリナイ $h: 3\sim 15 \,\mathrm{meg}/100 \,\mathrm{g}$, $n = 100 \,\mathrm{g}$ meq/100g, 454h: 10~40meq/100g, $N-\xi+294$ 100-150meq/100g、緑泥石: 10~40meq/100g、セピオラ イト及びアタパルジャイト: 20~30me q/100 gである。

【0010】本発明において用いられる粘土化合物は、 粘土化合物の表面が負電荷を帯びており、カチオン交換 能を有する粘土化合物である。具体的には、特に限定さ れるものではないが、例えば、カオリナイト、ディッカ イト、ハロイサイト等のカオリン化合物類、モンモリロ ナイト、ヘクトライト、バイデライト、サポナイト、テ ニオライト、ソーコナイト等のスメクタイト族類、白雲 母、パラゴナイト、イライト等の雲母族類、バーミキュ ライト族、マーガライト、クリントナイト等の脆雲母族 類、ドンバサイト、クッケアイト、クリノクロア等の緑 泥石族類、セピオライト及びパリゴルスカイト等が挙げ られる。これらの粘土化合物は天然に存在するが、人工 合成により不純物の少ないものを得ることもできる。本 発明において、粘土化合物とはここに示した天然の粘土 化合物及び人工合成により得られる粘土化合物を意味 し、それらが使用可能である。

【0011】本発明おいて、粘土化合物と反応せしめる 塩としては、アミン化合物のプロトン酸塩及びホスフィン化合物のプロトン酸塩、ホスホニウム塩、オキソニウム塩、スルホニウム塩、カルボニウム塩、銀塩もしくは フェロセニウム塩が挙げられる。

【0012】ここで、上記のアミン化合物のプロトン酸塩として用いられるものは、特に限定されるものではないが、例えば、メチルアミン塩酸塩、エチルアミン塩酸塩、ブチルアミン塩酸塩、sーブチルアミン塩酸塩、セーブチルアミン塩酸塩、ヘキシルアミン塩酸塩、2-アミノヘプタン塩酸塩、3-アミノヘプタン塩酸塩、ヘプ

チルアミン塩酸塩、1、5-ジメチルヘキシルアミン塩 酸塩、1-メチルヘプチルアミン塩酸塩、オクチルアミ ン塩酸塩、セーオクチルアミン塩酸塩、ノニルアミン塩 酸塩、デシルアミン塩酸塩、ウンデシルアミン塩酸塩、 ドデシルアミン塩酸塩、トリデシルアミン塩酸塩、1-テトラデシルアミン塩酸塩、ペンタデシルアミン塩酸 塩、1-ヘキサデシルアミン塩酸塩、オクタデシルアミ ン塩酸塩、オレイルアミン塩酸塩、シクロヘキシルアミ ン塩酸塩、シクロヘプチルアミン塩酸塩、シクロヘキサ ンメチルアミン塩酸塩、2-メチルシクロヘキシルアミ ン塩酸塩、4-メチルシクロヘキシルアミン塩酸塩、 2,3-ジメチルシクロヘキシルアミン塩酸塩、シクロ ドデシルアミン塩酸塩、2-(1-シクロヘキセニル) エチルアミン塩酸塩、ゲラニルアミン塩酸塩等の脂肪族 1級アミンのプロトン酸塩類、ジメチルアミン塩酸塩、 ジエチルアミン塩酸塩、ジブチルアミン塩酸塩、N-メ チルヘキシルアミン塩酸塩、ジヘキシルアミン塩酸塩、 ビス(2-エチルヘキシル)アミン塩酸塩、ジオクチル アミン塩酸塩、ジデシルアミン塩酸塩、ジドデシルアミ ン塩酸塩、ジテトラデシルアミン塩酸塩、ジヘキサデシ ルアミン塩酸塩、ジオクタデシルアミン塩酸塩、ジオレ イルアミン塩酸塩、N-メチルシクロヘキシルアミン塩 酸塩、N-エチルシクロヘキシルアミン塩酸塩、N-イ ソプロピルシクロヘキシルアミン塩酸塩、N-t-ブチ ルシクロヘキシルアミン塩酸塩、N-アリルシクロヘキ シルアミン塩酸塩等の脂肪族2級アミンのプロトン酸塩 類、N,N-ジメチルブチルアミン塩酸塩、N,N-ジ メチルヘキシルアミン塩酸塩、N, Nージメチルオクチ ルアミン塩酸塩、N、Nージメチルウンデシルアミン塩 酸塩、N, N-ジメチルドデシルアミン塩酸塩、N, N ージメチルテトラデシルアミン塩酸塩、N, N-ジメチ ルヘキサデシルアミン塩酸塩、N, N-ジメチルオクタ デシルアミン塩酸塩、N, N-ジオクチルメチルアミン 塩酸塩、N、N-ジウンデシルメチルアミン塩酸塩、 N, Nージドデシルメチルアミン塩酸塩、N, Nージテ トラデシルメチルアミン塩酸塩、N,N-ジヘキサデシ ルメチルアミン塩酸塩、N,N-ジオクタデシルメチル アミン塩酸塩、N, N-ジオレイルメチルアミン塩酸 塩、トリエチルアミン塩酸塩、トリブチルアミン塩酸 塩、トリヘキシルアミン塩酸塩、トリイソクチルアミン 塩酸塩、トリオクチルアミン塩酸塩、トリイソデシルア ミン塩酸塩、トリドデシルアミン塩酸塩、N,N-ジメ チルシクロヘキシルアミン塩酸塩、N,N-ジエチルシ クロヘキシルアミン塩酸塩等の脂肪族3級アミンのプロ トン酸塩類が挙げられる。

【0013】また、ピロリジン塩酸塩、ピペリジン塩酸塩、2,5ージメチルピロリジン塩酸塩、2ーメチルピペリジン塩酸塩、4ーメチルピペリジン塩酸塩、4ーメチルピペリジン塩酸塩、2,6ージメチルピペリジン塩酸塩、3,5ージ

メチルピペリジン塩酸塩、2-エチルピペリジン塩酸塩、2,2,6,6-チトラメチルピペリジン塩酸塩、1-メチルピロリジン塩酸塩、1-メチルピペリジン塩酸塩、1-エチルピペリジン塩酸塩、1-エチルピペリジン塩酸塩、1,2,2,6,6-ペンタメチルピペリジン塩酸塩等の脂肪族複素環式アミンのプロトン酸塩類が挙げられる。

【0014】さらに、アニリン塩酸塩、o-トルイジン 塩酸塩、mートルイジン塩酸塩、pートルイジン塩酸 塩、2,3-ジメチルアニリン塩酸塩、2,4-ジメチ ルアニリン塩酸塩、2,5-ジメチルアニリン塩酸塩、 2,6-ジメチルアニリン塩酸塩、3,4-ジメチルア ニリン塩酸塩、3、5-ジメチルアニリン塩酸塩、2-エチルアニリン塩酸塩、3-エチルアニリン塩酸塩、4 ーエチルアニリン塩酸塩、6-エチル-o-トルイジン 塩酸塩、2-イソプロピルアニリン塩酸塩、4-イソプ ロピルアニリン塩酸塩、2-t-ブチルアニリン塩酸 塩、4-ブチルアニリン塩酸塩、4-s-ブチルアニリ ン塩酸塩、4-t-ブチルアニリン塩酸塩、2,6-ジ エチルアニリン塩酸塩、2-イソプロピル-6-メチル アニリン塩酸塩、2-クロロアニリン塩酸塩、3-クロ ロアニリン塩酸塩、4ークロロアニリン塩酸塩、2ーブ ロモアニリン塩酸塩、3ーブロモアニリン塩酸塩、4-ブロモアニリン塩酸塩、o-アニシジン塩酸塩、m-ア ニシジン塩酸塩、p-アニシジン塩酸塩、o-フェネチ ジン塩酸塩、m-フェネチジン塩酸塩、p-フェネチジ ン塩酸塩、1-アミノナフタレン塩酸塩、2-アミノナ フタレン塩酸塩、1-アミノフルオレン塩酸塩、2-ア ミノフルオレン塩酸塩、3-アミノフルオレン塩酸塩、 4-アミノフルオレン塩酸塩、5-アミノインダン塩酸 塩、2-アミノビフェニル塩酸塩、4-アミノビフェニ ル塩酸塩、N-メチルーo-トルイジン塩酸塩、N-メ チルーmートルイジン塩酸塩、Nーメチルーpートルイ ジン塩酸塩、N-エチルーo-トルイジン塩酸塩、N-エチルーmートルイジン塩酸塩、N-エチルーpートル イジン塩酸塩、N-アリルーo-トルイジン塩酸塩、N ーアリルーmートルイジン塩酸塩、N-アリルーpート ルイジン塩酸塩、Nープロピルーoートルイジン塩酸 塩、Nープロピルーmートルイジン塩酸塩、Nープロピ ルーp - トルイジン塩酸塩、N, 2, 3 - トリメチルア ニリン塩酸塩、N, 2, 4ートリメチルアニリン塩酸 塩、N, 2, 5-トリメチルアニリン塩酸塩、N, 2, 6ートリメチルアニリン塩酸塩、N,3,4ートリメチ ルアニリン塩酸塩、N,3,5-トリメチルアニリン塩 酸塩、Nーメチルー2-エチルアニリン塩酸塩、N-メ チルー3ーエチルアニリン塩酸塩、N-メチル-4-エ チルアニリン塩酸塩、N-メチル-6-エチル-o-ト ルイジン塩酸塩、N-メチル-2-イソプロピルアニリ ン塩酸塩、N-メチル-4-イソプロピルアニリン塩酸 塩、N-メチル-2-t-ブチルアニリン塩酸塩、N-

メチルー4ーブチルアニリン塩酸塩、Nーメチルー4ー sーブチルアニリン塩酸塩、Nーメチルー4ーtーブチ ルアニリン塩酸塩、N-メチル-2,6-ジエチルアニ リン塩酸塩、N-メチル-2-イソプロピル-6-メチ ルアニリン塩酸塩、Nーメチルーpーアニシジン塩酸 塩、N-エチル-p-アニシジン塩酸塩、N, N-ジメ チルアニリン塩酸塩、N, N-ジエチルアニリン塩酸 塩、N, N-ジブチルアニリン塩酸塩、ジフェニルメチ ルアミン塩酸塩、トリフェニルアミン塩酸塩、N.N-ジメチルーoートルイジン塩酸塩、N、N-ジメチルー mートルイジン塩酸塩、N, N-ジメチルーpートルイ ジン塩酸塩、N,N,2,3-テトラメチルアニリン塩 酸塩、N、N、2、4ーテトラメチルアニリン塩酸塩、 N, N, 2, 5-テトラメチルアニリン塩酸塩、N, N. 2. 6 - テトラメチルアニリン塩酸塩、N. N. 3,4-テトラメチルアニリン塩酸塩、N,N,3,5 ーテトラメチルアニリン塩酸塩、N, N-ジメチル-2 -エチルアニリン塩酸塩、N, N-ジメチル-3-エチ ルアニリン塩酸塩、N,N-ジメチル-4-エチルアニ リン塩酸塩、N, N-ジメチル-6-エチル-o-トル イジン塩酸塩、N、N-ジメチル-2-イソプロピルア ニリン塩酸塩、N, N-ジメチル-4-イソプロピルア ニリン塩酸塩、N, N-ジメチル-2-t-ブチルアニ リン塩酸塩、N, N-ジメチル-4-s-ブチルアニリ ン塩酸塩、N、Nージメチルー4ーtーブチルアニリン 塩酸塩、N, N-ジメチル-2, 6-ジエチルアニリン 塩酸塩、N, Nージメチルー2ーイソプロピルー6ーメ チルアニリン塩酸塩、N, N-ジメチル-2-クロロア ニリン塩酸塩、N. Nージメチルー3ークロロアニリン 塩酸塩、N, N-ジメチル-4-クロロアニリン塩酸 塩、N, N-ジメチル-2-プロモアニリン塩酸塩、 N, N-ジメチル-3-ブロモアニリン塩酸塩、N, N ージメチルー4ーブロモアニリン塩酸塩、N, Nージメ チルーo-アニシジン塩酸塩、N. N-ジメチルーm-アニシジン塩酸塩、N,N-ジメチル-p-アニシジン 塩酸塩、N, N-ジメチル-o-フェネチジン塩酸塩、 N, N-ジメチル-m-フェネチジン塩酸塩、N, N-ジメチルーpーフェネチジン塩酸塩、N, Nージメチル -1-アミノナフタレン塩酸塩、N, N-ジメチル-2 ーアミノナフタレン塩酸塩、N, N-ジメチル-1-ア ミノフルオレン塩酸塩、N, N-ジメチル-2-アミノ フルオレン塩酸塩、N,N-ジメチル-3-アミノフル オレン塩酸塩、N, N-ジメチル-4-アミノフルオレ ン塩酸塩、N、N-ジメチル-5-アミノインダン塩酸 塩、N、N-ジメチル-2-アミノビフェニル塩酸塩、 N, N-ジメチル-4-アミノビフェニル塩酸塩、N, N-ジメチル-p-トリメチルシリルアニリン塩酸塩等 の芳香族アミンのプロトン酸塩類、またピリジン塩酸 塩、2-メチルピリジン塩酸塩、3-メチルピリジン塩 酸塩、4-メチルピリジン塩酸塩、キノリン塩酸塩、イ

ソキノリン塩酸塩等の複素環式芳香族アミンのプロトン 酸塩類が挙げられる。

【0015】さらに、ホスフィン化合物のプロトン酸塩 として通常用いられるものは、特に限定されるものでは ないが、例えば、トリフェニルホスフィン・ヒドロブロ マイド等が挙げられる。ホスホニウム塩として通常用い られるものは、特に限定されるものではないが、例え ば、テトラフェニルホスホニウムブロマイド、テトラフ ェニルホスホニウムクロライド、テトラフェニルホスホ ニウムアイオダイド等が挙げられる。オキソニウム塩と しては、特に限定されるものではないが、例えば、トリ エチルオキソニウムクロライド等が挙げられる。スルホ ニウム塩類としては、特に限定されるものではないが、 例えば、トリメチルスルホニウムアイオダイド等が挙げ られる。カルボニウム塩としては、特に限定されるもの ではないが、例えば、トリフェニルメチルクロライド、 トリフェニルメチルブロマイド等が挙げられる。銀塩と しては、特に限定されるものではないが、例えば、塩化 銀、臭化銀、ヨウ化銀等が挙げられる。フェロセニウム 塩としては、特に限定されるものではないが、例えば、 フェロセニウムクロライド、デカメチルフェロセニウム クロライド等が挙げられる。これらのうち活性や入手の 面から、アミン化合物のプロトン酸塩が好ましく用いら れる。

【0016】本発明に用いる変性粘土化合物は、前記の 粘土化合物と塩を溶媒中で接触させることにより調製で きる。変性粘土化合物を調製する際の反応条件は、特に 制限はない。

【0017】前記の粘土化合物と塩の反応量比は特に制限はないが、粘土化合物中に存在するカチオンと当量以上の塩を反応させることが好ましい。上記の粘土化合物は1種類を単独で使用しても、複数種類を混合してもよく、また塩も1種類を単独で使用しても、複数種類を混合してもよい。また、調製の際に用いる反応溶媒として、水もしくは極性を有する有機溶媒が用いられる。極性を有する有機溶媒としては、特に制限されるものではないが、例えば、メチルアルコール、エチルアルコール等のアルコール類、アセトン、メチルエチルケトン等のケトン類、テトラヒドロフラン等のエーテル類、N,Nージメチルホルムアミド等のアミド類、ジメチルスルホキシド等のスルホキシド等のアミド類、塩化メチレン等のハロゲン化炭化水素類が挙げられる。これらのうち、水及びアルコール類が好ましく用いられる。

【0018】本発明において用いられるアミン化合物のプロトン酸塩は、アミン化合物とプロトン酸を反応させて合成される。このプロトン酸塩を合成する際に用いられるプロトン酸としては、特に限定されるものではないが、例えば、塩化水素、フッ化水素、臭化水素、ヨウ化水素及び硫酸等が挙げられる。また、アミン化合物としては、特に限定されるものではないが、例えば、メチル

アミン、エチルアミン、ブチルアミン、sーブチルアミ ン、 tーブチルアミン、ヘキシルアミン、2ーアミノヘ プタン、3-アミノヘプタン、ヘプチルアミン、1,5 ージメチルヘキシルアミン、1-メチルヘプチルアミ ン、オクチルアミン、セーオクチルアミン、ノニルアミ ン、デシルアミン、ウンデシルアミン、ドデシルアミ ン、トリデシルアミン、1ーテトラデシルアミン、ペン タデシルアミン、1-ヘキサデシルアミン、オクタデシ ルアミン、オレイルアミン、シクロヘキシルアミン、シ クロヘプチルアミン、シクロヘキサンメチルアミン、2 ーメチルシクロヘキシルアミン、4-メチルシクロヘキ シルアミン、2、3-ジメチルシクロヘキシルアミン、 シクロドデシルアミン、2-(1-シクロヘキセニル) エチルアミン、ゲラニルアミン等の脂肪族1級アミン 類、ジメチルアミン、ジエチルアミン、ジブチルアミ ン、Nーメチルヘキシルアミン、ジヘキシルアミン、ビ ス(2-エチルヘキシル)アミン、ジオクチルアミン、 ジデシルアミン、ジドデシルアミン、ジテトラデシルア ミン、ジヘキサデシルアミン、ジオクタデシルアミン、 ジオレイルアミン、Nーメチルシクロヘキシルアミン、 N-エチルシクロヘキシルアミン、N-イソプロピルシ クロヘキシルアミン、Nーtーブチルシクロヘキシルア ミン、N-アリルシクロヘキシルアミン等の脂肪族2級 アミン類、N, N-ジメチルブチルアミン、N, N-ジ メチルヘキシルアミン、N. N-ジメチルオクチルアミ ン、N, N-ジメチルウンデシルアミン、N, N-ジメ チルドデシルアミン、N, N-ジメチルテトラデシルア ミン、N, N-ジメチルヘキサデシルアミン、N, N-ジメチルオクタデシルアミン、N、N-ジオクチルメチ ルアミン、N, N-ジウンデシルメチルアミン、N, N ージドデシルメチルアミン、N、N-ジテトラデシルメ チルアミン、N, Nージヘキサデシルメチルアミン、 N, N-ジオクタデシルメチルアミン、N, N-ジオレ イルメチルアミン、トリエチルアミン、トリブチルアミ ン、トリヘキシルアミン、トリイソクチルアミン、トリ オクチルアミン、トリイソデシルアミン、トリドデシル アミン、N, N-ジメチルシクロヘキシルアミン、N, N-ジエチルシクロヘキシルアミン等の脂肪族3級アミ ン類が挙げられる。

【0019】また、ピロリジン、ピペリジン、2,5-ジメチルピロリジン、2-メチルピペリジン、3-メチルピペリジン、4-メチルピペリジン、2,6-ジメチルピペリジン、3,5-ジメチルピペリジン、2,2,6,6-テトラメチルピペリジン、1-メチルピロリジン、1-メチルピペリジン、1-エチルピペリジン、1-ブチルピペリジン、1,2,2,6,6-ベンタメチルピペリジン等の脂肪族核素環式アミン類が挙げられる

【0020】さらに、oートルイジン、mートルイジ

ン、p-トルイジン、2,3-ジメチルアニリン、2, 4-ジメチルアニリン、2,5-ジメチルアニリン、 2,6-ジメチルアニリン、3,4-ジメチルアニリ ン、3,5-ジメチルアニリン、2-エチルアニリン、 3-エチルアニリン、4-エチルアニリン、6-エチル -o-トルイジン、2-イソプロピルアニリン、4-イ ソプロピルアニリン、2-t-ブチルアニリン、4-ブ チルアニリン、4-s-ブチルアニリン、4-t-ブチ ルアニリン、2、6ージエチルアニリン、2ーイソプロ ピルー6-メチルアニリン、2-クロロアニリン、3-クロロアニリン、4ークロロアニリン、2ープロモアニ リン、3-ブロモアニリン、4-ブロモアニリン、0-アニシジン、mーアニシジン、pーアニシジン、oーフ ェネチジン、m-フェネチジン、p-フェネチジン、1 -アミノナフタレン、2-アミノナフタレン、1-アミ ノフルオレン、2-アミノフルオレン、3-アミノフル オレン、4ーアミノフルオレン、5ーアミノインダン、 2ーアミノビフェニル、4ーアミノビフェニル、Nーメ チルーoートルイジン、Nーメチルーmートルイジン、 Nーメチルーpートルイジン、Nーエチルーoートルイ ジン、N-エチルーmートルイジン、N-エチルーp-トルイジン、Nーアリルーoートルイジン、Nーアリル -m-トルイジン、N-アリル-p-トルイジン、N-プロピルーoートルイジン、N-プロピルーm-トルイ ジン、N-プロピルーp-トルイジン、N, 2, 3-ト リメチルアニリン、N, 2, 4-トリメチルアニリン、 チルアニリン、N, 3, 4-トリメチルアニリン、N, 3,5-トリメチルアニリン、N-メチル-2-エチル アニリン、N-メチル-3-エチルアニリン、N-メチ ルー4-エチルアニリン、N-メチルー6-エチルーo ートルイジン、N-メチル-2-イソプロピルアニリ ン、N-メチルー4-イソプロピルアニリン、N-メチ ルー2ーtーブチルアニリン、Nーメチルー4ーブチル アニリン、N-メチル-4-s-ブチルアニリン、N-メチル-4-t-ブチルアニリン、N-メチル-2,6 ージエチルアニリン、Nーメチルー2-イソプロピルー 6-メチルアニリン、N-メチル-p-アニシジン、N ーエチルーpーアニシジン、N, Nージメチルアニリ ン、N, N-ジエチルアニリン、N, N-ジブチルアニ リン、ジフェニルメチルアミン、トリフェニルアミン、 N, N-ジメチル-o-トルイジン、N, N-ジメチル -m-トルイジン、N, N-ジメチル-p-トルイジ ン、N, N, 2, 3-テトラメチルアニリン、N, N, 2, 4-\(\tau\)-\(\tau\ ラメチルアニリン、N, N, 2, 6-テトラメチルアニ リン、N, N, 3, 4ーテトラメチルアニリン、N, N. 3, 5-テトラメチルアニリン、N, N-ジメチル -2-エチルアニリン、N, N-ジメチル-3-エチル アニリン、N、N - ジメチルー 4 - エチルアニリン、

N, N-ジメチル-6-エチル-o-トルイジン、N, N-ジメチル-2-イソプロピルアニリン、N, N-ジ メチルー4ーイソプロピルアニリン、N, Nージメチル -2-t-ブチルアニリン、N, N-ジメチル-4-s ーブチルアニリン、N, N-ジメチル-4-t-ブチル アニリン、N, N-ジメチル-2, 6-ジエチルアニリ ン、N, N-ジメチル-2-イソプロピル-6-メチル アニリン、N, Nージメチルー2ークロロアニリン、 N、N-ジメチル-3-クロロアニリン、N、N-ジメ チルー4ークロロアニリン、N, N-ジメチルー2ーブ ロモアニリン、N, N-ジメチル-3-ブロモアニリ ン、N, N-ジメチル-4-ブロモアニリン、N, N-ジメチルーoーアニシジン、N、Nージメチルーmーア ニシジン、N, Nージメチルーpーアニシジン、N, N ージメチルーoーフェネチジン、N, N-ジメチル-m ーフェネチジン、N, N-ジメチル-p-フェネチジ ン、N, N-ジメチル-1-アミノナフタレン、N, N ージメチルー2ーアミノナフタレン、N, Nージメチル -1-アミノフルオレン、N, N-ジメチル-2-アミ ノフルオレン、N, N-ジメチル-3-アミノフルオレ ン、N, Nージメチルー4ーアミノフルオレン、N, N ージメチルー5ーアミノインダン、N, Nージメチルー 2-アミノビフェニル、N, N-ジメチル-4-アミノ ビフェニル、N, Nージメチルーpートリメチルシリル アニリン等の芳香族アミン類、またピリジン、2-メチ ルピリジン、3-メチルピリジン、4-メチルビリジ ン、キノリン、イソキノリン等の複素環式芳香族アミン 類が挙げられる。なお、粘土化合物と反応せしめるアミ ン化合物のプロトン酸塩は、予めアミン化合物とプロト ン酸を反応させて単離したものを用いてもよいし、粘土 化合物と反応させる際の反応溶媒中で生成させてもよ

【0021】本発明において、変性粘土化合物の使用量は特に制限されるものではないが、後記のクロム錯体1 モルに対して0.01 \sim 10000kgであり、好ましくは0.1 \sim 1000kg、より好ましくは1 \sim 500kgである。

【0022】本発明において、エチレンの三量化触媒を 構成する一成分として、中性の多座配位子が配位したクロム錯体が用いられる。中性の多座配位子が配位したクロム錯体は、下記一般式(1) ACrB。 (1)

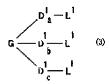
(式中、Aは中性の多座配位子である。nは1~3の整数であり、Bは水素原子、炭素数1~10の炭化水素基、カルボキシレート基もしくはジケトナート基、ハロゲン原子、アミド、イミド、アルコキシド、チオアルコキシド、カルボニル、アレーン、アルケン、アルキン、アミン、イミン、ニトリル、イソニトリル、ホスフィン、ホスフィンオキシド、ホスファイト、エーテル、スルホン、スルホキシド及びスルフィドからなる群より選

ばれる1種以上を表す)で示される錯体が好適なものと して挙げられる。

【0023】ここで、クロム錯体に配位させる中性の多 座配位子として用いられるものは、特に限定されるもの ではないが、例えば、下記一般式(3)

[0024]

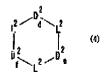
【化1】



【0025】(式中、a, b, cはそれぞれ独立した0 ~6の整数である。D1はそれぞれ独立して置換基を有 していてもよい2価の炭化水素基、L¹はそれぞれ独立 して置換基を有していてもよいヘテロ元素基又は複素環 式化合物を表す。また、Gは炭化水素、ケイ素、窒素又 はリンを表す)で示される三脚型構造を有する多座配位 子、下記一般式(4)

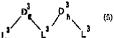
[0026]

【化2】



【0027】(式中、d, e, f はそれぞれ独立した1 ~6の整数である。D2はそれぞれ独立して置換基を有 していてもよい2価の炭化水素基、L²はそれぞれ独立 して置換基を有していてもよいヘテロ元素基を表す)で 示される環状型構造を有する多座配位子及び下記一般式 (5)

[0028] 【化3】



【0029】(式中、g, hはそれぞれ独立した0~6 の整数である。D³はそれぞれ独立して置換基を有して いてもよい2価の炭化水素基、L3はそれぞれ独立して 置換基を有していてもよいヘテロ元素基又は複素環式化 合物を表す)で示されるブリッジ型構造を有する多座配 位子等が挙げられる。

【0030】上記一般式(3)、(4)及び(5)にお いて、D1、D2及びD3は、特に限定されるものではな いが、例えば、アルキレン基、シクロアルキレン基、フ ェニレン基、トリレン基、キシリレン基等が挙げられ る。また、その置換基としては、例えば、メチル基、エ チル基等のアルキル基類、メトキシ基、エトキシ基等の アルコキシ基類等が挙げられる。

【0031】一般式(3)、(4)及び(5)におい て、L1、L2及びL3で示されるヘテロ元素基は、特に 限定されるものではないが、例えば、メトキシ基、エト キシ基、プロポキシ基、ブトキシ基等のアルコキシ基 類、フェノキシ基、2,6-ジメチルフェノキシ基等の アリールオキシ基類、メチルチオ基、エチルチオ基、プ ロピルチオ基、ブチルチオ基等のアルキルチオ基類、フ ェニルチオ基、トリルチオ基等のアリールチオ基類。ジ メチルアミノ基、ジエチルアミノ基、ビス(トリメチル) シリル) アミノ基等のジアルキルアミノ基類、ジフェニ ルアミノ基等のジアリールアミノ基類、メチルフェニル 基等のアルキルアリールアミノ基類、ジメチルホスフィ ノ基、ジエチルホスフィノ基等のジアルキルホスフィノ 基、ジフェニルホスフィノ基、ジトリルホスフィノ基等 のジアリールホスフィノ基、メチルフェニルホスフィノ 基等のアルキルアリールホスフィノ基類が挙げられる。 【0032】また、一般式(3)及び(5)において、 L¹及びL³で示される複素環式化合物は、特に限定され るものではないが、例えば、フリル基、ベンゾフリル 基、チエニル基、ベンゾチエニル基、ピラゾリル基、ト リアゾリル基、テトラゾリル基、ピリジル基、イミダゾ リル基、ベンゾイミダゾリル基、インダゾリル基、キノ リル基、イソキノリル基、オキサゾリル基、チアゾール 基等が挙げられる。これらのヘテロ元素基及び複素環式 化合物の置換基としては、例えば、メチル基、エチル 基、プロピル基、ブチル基、オクチル基、フェニル基等 が挙げられる。

【0033】上記一般式(3)におけるGとしては、特 に限定されるものではないが、例えば、メタン、エタ ン、プロパン、ブタン、ヒドロキシメタン、メチルシラ ン、フェニルシラン、アミン、アミンオキシド、ホスフ ィン、ホスフィンオキシド等が挙げられる。

【0034】上記一般式(3)で示される三脚型構造を 有する多座配位子として通常用いられるものは、特に限 定されるものではないが、例えば、トリス(メトキシメ チル) メタン、1, 1, 1-トリス (メトキシメチル) エタン、1,1,1ートリス (メトキシメチル) プロパ ン、1, 1, 1-トリス (メトキシメチル) ブタン、 1, 1, 1-トリス (エトキシメチル) エタン、1, 1,1-トリス(プロポキシメチル)エタン、1,1, 1-トリス (ブトキシメチル) エタン、1, 1, 1-ト リス (フェノキシメチル) エタン、トリフリルメタン、 トリス (5-メチルー2-フリル) メタン、トリス (5 ーエチルー2-フリル) メタン、トリス (5-ブチルー 2-フリル)メタン、1,1,1-トリフリルエタン、 トリフリルアミン、トリフリルホスフィン、トリフリル ホスフィンオキシド等の含酸素多座配位子類、1,1, 1ートリス (メチルチオメチル) エタン、1, 1, 1-トリス (ブチルチオメチル) エタン、1、1、1-トリ

ス (フェニルチオメチル) エタン、トリス (チエニル) メタン等の含イオウ多座配位子類、1.1.1-トリス (ジメチルアミノメチル) エタン、1,1,1-トリス (ジフェニルアミノメチル) エタン、トリス (ピラゾリ ル) メタン、トリス(3,5ージメチルー1ーピラゾリ ル)メタン、トリス(3,5ージイソプロピルー1ーピ ラゾリル) メタン、1、1、1-トリス(3、5-ジメ チルー1ーピラゾリル) エタン、1、1、1ートリス (3, 5-ジメチルー1ーピラゾリル) プロパン、1、1, 1-トリス(3, 5-ジメチル-1-ピラゾリル) ブタン、トリス(2-ピリジル)メタン、トリス(6-メチルー2ーピリジル) メタン、トリス(2ーピリジ ル) アミン、トリス (2-ピリジル) ホスフィン、トリ ス(2-ピリジル) ホスフィンオキシド、トリス(2-ピリジル) ヒドロキシメタン、トリス(1-イミダゾリ ル)メタン等の含窒素多座配位子類、1,1,1-トリ ス(ジフェニルホスフィノメチル)エタン、1,1,1 ートリス (ジメチルホスフィノメチル) エタン、1. 1,1-トリス(ジエチルホスフィノメチル)エタン等 の含リン多座配位子類が挙げられる。

【0035】また、環状型構造を有する多座配位子とし ては、特に限定されるものではないが、例えば、1, 3,5-トリメチルー1,3,5-トリアザシクロヘキ サン、1,3,5-トリエチル-1,3,5-トリアザ シクロヘキサン、1、3、5-トリーiープロピルー 1,3,5-トリアザシクロヘキサン、1,3,5-ト リーtーブチルー1,3,5-トリアザシクロヘキサ ン、1,3,5-トリーn-ブチル-1,3,5-トリ アザシクロヘキサン、1,3,5-トリシクロヘキシル -1, 3, 5-トリベンジルー1,3,5-トリアザシクロヘキサン、 1,3,5-トリフェニルー1,3,5-トリアザシク ロヘキサン、2,4,6-トリメチル-1,3,5-ト リアザシクロヘキサン、1,4,7-トリアザシクロノ ナン、1,4,7ートリメチルー1,4,7ートリアザ シクロノナン、1,4,7-トリエチル-1,4,7-トリアザシクロノナン、1,4,7-トリーi-プロピ ル-1, 4, 7-トリアザシクロノナン、1, 4, 7-トリーセーブチルー1,4,7-トリアザシクロノナ ン、1、4、7-トリシクロヘキシル-1、4、7-ト リアザシクロノナン、1.4.7-トリフェニルー1. 4,7-トリアザシクロノナン等の含窒素多座配位子 類、1,3,5-トリチアシクロヘキサン、1,4,7 ートリチアシクロノナン、1,4,7,10-テトラチ アシクロドデカン、1,5,9,13-テトラチアへキ サデカン等の含イオウ多座配位子類、1,3,5-トリ オキサシクロヘキサン、1,4,7-トリオキサシクロ ノナン、12-クラウン-4、15-クラウン-5、1 8-クラウン-6等の含酸素多座配位子類が挙げられ ъ.

【0036】ブリッジ型構造を有する多座配位子として は、特に限定されるものではないが、例えば、ビス(ジ メチルホスフィノエチル) メチルホスフィン、 ビス (ジ フェニルホスフィノエチル)フェニルホスフィン等の含 リン多座配位子類、ジエチレントリアミン、ビス(ジメ チルアミノエチル) メチルアミン、ビス (ジエチルアミ ノエチル) エチルアミン、ビス (フェニルアミノエチ ν) アミン、 α , α' , α'' -トリピリジン、2, 6-ビス(2-フェニル-2-アザエテニル) ピリジン、ビ ス[3-(2-ピリジルエチルイミノ)-2-ブタノン オキシム] 等の含窒素多座配位子類、ジエチレングリコ ールメチルエーテル、ビス (メトキシエチル) エーテ ル、ビス (エトキシエチル) エーテル、ビス (ブトキシ エチル) エーテル、(tーブトキシエチル) (メトキシ エチル) エーテル等の含酸素多座配位子類が挙げられ る。

【0037】また、上記一般式(1)のBにおいて、炭 素数1~10の炭化水素基としては、特に限定されるも のではないが、例えば、メチル基、エチル基、プロピル 基、ブチル基、シクロヘキシル基、ベンジル基又はフェ ニル基等が挙げられる。炭素数1~10のカルボキシレ ート基としては、特に限定されるものではないが、例え ば、アセテート基、ナフテネート基又は2-エチルヘキ サノエート基等が挙げられる。炭素数1~10のジケト ナート基としては、特に限定されるものではないが、例 えば、アセチルアセトナート基等が挙げられる。ハロゲ ン原子としては、特に限定されるものではないが、例え ば、フッ素原子、塩素原子、臭素原子又はヨウ素原子等 が挙げられる。アミド基としては、特に限定されるもの ではないが、例えば、ジメチルアミド基、ジエチルアミ ド基、ジイソプロピルアミド基、ジオクチルアミド基、 ジデシルアミド基、ジドデシルアミド基、ビス (トリメ チルシリル) アミド基、ジフェニルアミド基、N-メチ ルアニリド又はアニリド基等が挙げられる。イミド基と しては、特に限定されるものではないが、例えば、ベン ゾフェノンイミド等が挙げられる。アルコキシド基とし ては、特に限定されるものではないが、例えば、メトキ シド基、エトキシド基、プロポキシド基、ブトキシド基 又はフェノキシド基等が挙げられる。チオアルコキシド 基としては、特に限定されるものではないが、例えば、 チオメトキシド基、チオエトキシド基、チオプロポキシ ド基、チオブトキシド基又はチオフェノキシド基等が挙 げられる。アレーンとしては、特に限定されるものでは ないが、例えば、ベンゼン、トルエン、キシレン、トリ メチルベンゼン、ヘキサメチルベンゼン又はナフタレン 等が挙げられる。アルケンとしては、特に限定されるも のではないが、例えば、エチレン、プロピレン、ブテ ン、ヘキセン又はデセン等が挙げられる。アルキンとし ては、特に限定されるものではないが、例えば、アセチ レン、フェニルアセチレン又はジフェニルアセチレン等

が挙げられる。アミンとしては、特に限定されるもので はないが、例えば、トリエチルアミン又はトリプチルア ミン等が挙げられる。イミンとしては、特に限定される ものではないが、例えば、ベンゾフェノンイミン又はメ チルエチルケトンイミン等が挙げられる。ニトリルとし ては、特に限定されるものではないが、例えば、アセト ニトリル又はベンゾニトリル等が挙げられる。イソニト リルとしては、特に限定されるものではないが、例え ば、セーブチルイソニトリル又はフェニルイソニトリル 等が挙げられる。ホスフィンとしては、特に限定される ものではないが、例えば、トリフェニルホスフィン、ト リトリルホスフィン、トリシクロヘキシルホスフィン又 はトリブチルホスフィン等が挙げられる。ホスフィンオ キシドとしては、特に限定されるものではないが、例え ば、トリプチルホスフィンオキシド又はトリフェニルホ スフィンオキシド等が挙げられる。ホスファイトとして は、特に限定されるものではないが、例えば、トリフェ ニルホスファイト、トリトリルホスファイト、トリブチ ルホスファイト又はトリエチルホスファイト等が挙げら れる。エーテルとしては、特に限定されるものではない が、例えば、ジエチルエーテル又はテトラヒドロフラン 等が挙げられる。スルホンとしては、特に限定されるも のではないが、例えば、ジメチルスルホン又はジブチル スルホン等が挙げられる。スルホキシドとしては、特に 限定されるものではないが、例えば、ジメチルスルホキ シド又はジブチルスルホキシド等が挙げられる。スルフ ィドとしては、特に限定されるものではないが、例え ば、エチルスルフィド又はブチルスルフィド等が挙げら れる。

【0038】上記一般式(1)で示される中性の多座配 位子が配位したクロム錯体の具体的な例としては、特に 限定されるものではないが、例えば、トリス (メトキシ メチル)メタンクロムトリクロライド(I I I)、1, 1,1-トリス(メトキシメチル)エタンクロムトリカ ルボニル(0)、1, 1, 1-トリス(メトキシメチル)エタンクロムトリクロライド(III)、1、1、1、 **1ートリス (メトキシメチル) エタンートリス (ジイソ** プロピルアミド) クロム (III)、1,1,1-トリ ス (メトキシメチル) エタンートリス (ジメチルアミ ド) クロム (III)、1,1,1-トリス (メトキシ メチル) エタンートリス 「ビス (トリメチルシリル) ア ミド] クロム (III)、1,1,1-トリス (メトキ シメチル) エタンクロムトリエトキシド (111)、 1, 1, 1-トリス (メトキシメチル) エタンクロムト リチオプトキシド(III)、1,1,1-トリス (エ トキシメチル) エタンクロムトリクロライド (II I)、1,1,1-トリス (ブトキシメチル) エタンク ロムトリクロライド(III)、1,1,1-トリス (フェノキシメチル) エタンクロムトリクロライド (I II)、トリフリルメタンクロムトリカルボニル。

(0)、トリス(5-メチル-2-フリル)メタンクロ ムトリカルボニル(0)、トリス(5ープチルー2-フ リル) メタンクロムトリカルボニル(0)、トリフリル アミンクロムトリカルボニル(0)、トリフリルホスフ ィンクロムトリカルボニル(0)、トリフリルホスフィ ンオキシドクロムトリカルボニル(0)、1,1,1-トリス (メチルチオメチル) エタンクロムトリカルボニ ル(0)、トリス(チエニル)メタンクロムトリカルボ ニル(0)、1,1,1-トリス(ジメチルアミノメチ ル) エタンクロムトリカルボニル(0)、トリス(ピラ ゾリル) メタンクロムトリカルボニル(0)、トリス (3,5-ジメチル-1-ピラゾリル)メタンクロムト リカルボニル(0)、トリス(3,5-ジメチルー1ー ピラゾリル) メタンクロムトリクロライド(1 1 1)、 トリス(3,5-ジメチル-1-ピラゾリル)メタンー トリス (ジエチルアミド) クロム (III)、トリス (3,5-ジメチル-1-ピラゾリル)メタンートリス (ジイソプロピルアミド) クロム(III)、トリス (3,5-ジメチル-1-ピラゾリル) メタンートリス [ビス(トリメチルシリル)アミド]クロム(II I)、トリス(3、5ージメチルー1ーピラゾリル)メ タンートリス (ベンゾフェノンイミド) クロム (II I)、トリス(3,5~ジメチル-1-ピラゾリル)メ タンクロムトリエトキシド(III)、トリス(3,5 -ジメチル-1-ピラゾリル) メタンクロムトリチオブ トキシド(III)、トリス(3、5ージメチルー1ー ピラゾリル) メタンートルエンクロム(0)、トリス (3,5-ジメチルー1-ピラゾリル)メタンクロム (エチレン) ジカルボニル(0)、トリス(3,5-ジ メチルー1ーピラゾリル) メタンクロム (フェニルアセ チレン) ジカルボニル(0)、トリス(3,5-ジメチ ルー1-ピラゾリル) メタンクロム (ジメチルアニリ ン) ジカルボニル(0)、トリス(3,5-ジメチルー 1-ピラゾリル) メタンクロム (ベンゾフェノンイミ ン) ジカルボニル(0)、トリス(3,5ージメチルー 1-ピラゾリル) メタンクロム (アセトニトリル) ジカ ルボニル(0)、トリス(3,5-ジメチル-1-ピラ **ゾリル) メタンクロム (tーブチルイソニトリル) ジカ** ルボニル(0)、トリス(3,5-ジメチル-1-ピラ ゾリル) メタンクロム (トリブチルホスフィン) ジカル ボニル(0)、トリス(3,5-ジメチルー1ーピラゾ リル) メタンクロム(トリブチルホスフィンオキシド) ジカルボニル(0)、トリス(3,5-ジメチルー1ー ピラゾリル) メタンクロム (トリフェニルホスファイ ト) ジカルボニル(0)、トリス(3,5-ジメチルー 1-ピラゾリル) メタンクロム (テトラヒドロフラン) ジカルボニル(0)、トリス(3,5-ジメチルー1ー ピラゾリル)メタンクロム (ジメチルスルホン) ジカル ボニル(0)、トリス(3,5-ジメチル-1-ピラゾ リル)メタンクロム(ジメチルスルホキシド)ジカルボ

ニル(0)、トリス(3、5ージメチルー1ーピラゾリ ル)メタンクロム(ジブチルスルフィド)ジカルボニル (0)、トリス(3,5ージイソプロピルー1ーピラゾ リル) メタンクロムトリカルボニル(0)、1,1,1 ートリス(3,5ージメチルー1ーピラゾリル)エタン クロムトリカルボニル(0)、1,1,1-トリス (3, 5-ジメチルー1ーピラゾリル) プロパンクロム トリカルボニル(0)、1,1,1-トリス(3,5-ジメチルー1ーピラゾリル) ブタンクロムトリカルボニ ル(0)、トリス(2ーピリジル)メタンクロムトリカ ルボニル(0)、トリス(6-メチル-2-ピリジル) メタンクロムトリカルボニル(0)、トリス(2-ピリ ジル) アミンクロムトリカルボニル(0)、トリス(2 ーピリジル) ホスフィンクロムトリカルボニル (0). トリス(2-ピリジル) ホスフィンオキシドクロムトリ カルボニル(0)、トリス(1-イミダゾリル)メタン クロムトリカルボニル(0)、1,1,1-トリス(ジ フェニルホスフィノメチル) エタンクロムトリカルボニ ル(0)、1,1,1-トリス(ジフェニルホスフィノメチル) エタンクロムトリクロライド(III)、1, 1,1-トリス(ジメチルホスフィノメチル)エタンク ロムトリカルボニル(0)、1,1,1-トリス(ジエ チルホスフィノメチル) エタンクロムトリカルボニル (0)、1,1,1-トリス(ジエチルホスフィノメチ ル) エタンクロムトリクロライド(III)、1、1、1、 1-トリス (ジエチルホスフィノメチル) エタンートリ ス (ジイソプロピルアミド) クロム (I I I) 等の三脚 型構造を有する多座配位子が配位したクロム錯体が挙げ られる。

【0039】また、1、3、5-トリエチルー1、3、 **5ートリアザシクロヘキサンクロムトリカルボニル** (0)、1,3,5-トリーiープロピル-1,3,5 ートリアザシクロヘキサンクロムトリカルボニル (0)、1, 3, 5-トリーi-プロピルー1, 3, 5ートリアザシクロヘキサンクロムトリクロライド(II 1)、1,3,5-トリーi-プロピルー1,3,5-トリアザシクロヘキサンクロムジクロライド(II)、 ジクロロフェニルクロムー1,3,5-トリメチルー 1,3,5-トリアザシクロヘキサンクロム(II I), $\Im \rho u u \tau_x = \mu \rho u \Delta - 1$, 3, $5 - \mu u = i$ ープロピルー1、3、5ートリアザシクロヘキサンクロ $\Delta(III)$, 1, 3, 5-hJ-t-J+h-1, 3,5-トリアザシクロヘキサンクロムトリカルボニル (0), 1, 3, 5-->y-t- $7+\nu-1$, 3, 5-トリアザシクロヘキサンクロムトリクロライド(II 1)、1,3,5-トリーセーブチルー1,3,5-ト リアザシクロヘキサンートリス (ジイソプロピルアミ ド) クロム(III)、1,3,5-トリシクロヘキシ ルー1, 3, 5ートリアザシクロヘキサンクロムトリカ $\nu \pi = \nu (0), 2, 4, 6 - \nu \times \nu = 1, 3, 5$

ートリアザシクロヘキサンクロムトリカルボニル (0), 1, 4, 7-1ザシクロノナンクロムトリクロライド(III)、1, 4,7-トリーセーブチルー1,4,7-トリアザシク ロノナンクロムトリカルボニル(0)、1、3、5ート リチアシクロヘキサンクロムトリカルボニル(0)、 1, 4, 7-トリチアシクロノナンクロムトリカルボニ ル(0)、1,3,5-トリオキサシクロヘキサンクロ ムトリカルボニル(0)、1、4、7-トリオキサシク ロノナンクロムトリカルボニル(0)等の環状型構造を 有する多座配位子が配位したクロム錯体が挙げられる。 【0040】さらに、ビス (ジメチルホスフィノエチ ル) メチルホスフィンクロムトリクロライド (I I I) 、ビス(ジフェニルホスフィノエチル)フェニルホ スフィンクロムトリカルボニル(0)、ビス(ジフェニ ルホスフィノエチル) フェニルホスフィンクロムトリク ロライド(III)、ジエチレントリアミンクロムトリ カルボニル(0)、ビス(ジメチルアミノエチル)メチ ν r $> \nu$ r $> \nu$ $> \nu$ α" - トリピリジンクロムトリクロライド(ΙΙΙ)、 2,6-ビス(2-フェニル-2-アザエテニル)ピリ ジンクロムトリクロライド(III)、ビス[3-(2 -ピリジルエチルイミノ) -2-ブタノンオキシム] ク ロムトリクロライド(III)、ビス(メトキシエチ ル) エーテルクロムトリクロライド(III)、ビス (エトキシエチル) エーテルクロムトリクロライド (I II)等のブリッジ型構造を有する多座配位子が配位し たクロム錯体が挙げられる。

【0041】これらのうち、1-ヘキセン選択性や触媒活性の面から、一般式(1)の中性の多座配位子としては三脚型構造を有する多座配位子が好ましく用いられる。また、Bとしてはカルボニル、炭素数1~10の炭化水素基、ハロゲン原子、アミド及びチオアルコキシドが好ましく用いられる。より好ましくは三脚型構造を有する多座配位子が配位したクロムのカルボニル錯体、ハロゲン錯体及びアミド錯体が用いられる。さらに好ましくは、トリス(3,5-ジメチル-1-ピラゾリル)メタンクロムトリカルボニル(0)、トリス(3,5-ジメチル-1-ピラゾリル)メタンクロムトリカレライド(III)、トリス(3,5-ジメチル-1-ピラゾリル)メタンクロムトリカーでライリス(ジイソプロビル)アミド(III)、1,1,1-トリス(メトキシメチル)エタンクロムトリカルボニル(0)等が用いられる。

【0042】本発明において、上記の中性の多座配位子が配位したクロム錯体の合成法は、特に限定されるものではないが、例えば、中性の多座配位子とクロム化合物とから公知の錯体形成法 [例えば、J. Amer. Chem. Soc., 92, 5118 (1970) 及びAngew. Chem. Int. Ed. Engl., 33, 1877 (1994)等]により容易に合成することが

できる。この場合、使用できるクロム化合物としては、 特に限定されるものではないが、例えば、クロムヘキサ カルボニル(0)、ペンタカルボニル(トリフェニルホ スフィン) クロム(0)、テトラカルボニルビス(エチ レン)クロム(0)、トリカルボニル(ベンゼン)クロ ム(0)、トリカルボニル(トルエン)クロム(0)、 トリカルボニル(トリメチルベンゼン)クロム(0)、 トリカルボニル (ヘキサメチルベンゼン) クロム (0)、トリカルボニル(ナフタレン)クロム(0)、 トリカルボニル (シクロヘプタトリエン) クロム (0)、トリカルボニルトリス(アセトニトリル)クロ ム(0)、トリカルボニルトリス(トリフェニルホスフ ァイト)クロム(0)、(エチレン)ジカルボニル(ト リメチルベンゼン)クロム(0)、シクロヘキシルイソ ニトリルジカルボニル (トリメチルベンゼン)クロム (0)、トリブチルホスフィンジカルボニル(トリメチ ルベンゼン)クロム(0)、トリカルボニル(シクロペ ンタジエニル) クロム(I) ダイマー、ヒドリドトリカ ルボニル (シクロペンタジエニル) クロム (I I) 等の クロムカルボニル化合物類、塩化クロム(III)、塩 化クロム(III)、臭化クロム(III)、臭化クロム (II)、ヨウ化クロム(III)、ヨウ化クロム(I 1)、フッ化クロム(III)、フッ化クロム(I I)、トリス(テトラヒドロフラン)クロムクロライド (111)、トリス(1,4-ジオキサン)クロムクロ ライド(III)、トリス(ジエチルエーテル)クロム クロライド(III)、トリス(ピリジン)クロムクロ ライド (III) 、トリス (アセトニトリル) クロムク ロライド(III)等のクロムハロゲン化物類、トリス (テトラヒドロフラン) クロムトリス (ジイソプロピル アミド) (I I I) 、トリス (テトラヒドロフラン) ク ロムトリス (ジエチルアミド) (I I I) 等のクロムア ミド類、クロム(IV)t-ブトキシド等のクロムアル コキシド類、クロム(III)アセチルアセトナート等 のクロムジケトナート類、クロム(III)2-エチル ヘキサノエート、クロム (I I I) アセテート、クロム (III) ナフテネート等のクロムカルボン酸塩類が挙 げられる。

【0043】中性の多座配位子とクロム化合物を反応させ、クロム錯体を形成させる際のクロム金属の濃度は特に制限されない。また、ここで用いられる溶媒としては、特に限定されるものではないが、有機溶媒が好ましく用いられる。例えば、ペンタン、ヘキサン、ヘプタン、オクタン、ノナン、デカン、シクロヘキサン、デカリン等の脂肪族炭化水素類、ベンゼン、トルエン、キシレン、クメン、トリメチルベンゼン等の芳香族炭化水素類、ジエチルエーテル、テトラヒドロフラン等のエーテル類、塩化メチレン、クロロホルム、四塩化炭素等のハロゲン化炭化水素類が挙げられる。また、上記溶媒は、それぞれ単独で使用し得るのみならず、二種以上を混合

して用いることも可能である。

【0044】また、錯体形成反応は、0℃から使用する 反応溶媒の沸点までの任意の温度で行われ、好ましくは 20~200℃である。反応時間は特に制限されず、通 常1分~48時間、好ましくは5分~24時間である。 なお、反応時のすべての操作は、空気と水分を避けて行 なうことが望ましい。また、原料及び溶媒は十分に乾燥 しておくことが好ましい。

【0045】中性の多座配位子が配位したクロム錯体は、通常固体として沈殿するので、ろ過により反応溶媒から分離できる。さらに必要に応じて、上記溶媒を用いて洗浄を行い、次いで乾燥して、エチレンの三量化触媒の構成成分の一つであるクロム錯体が合成される。尚、沈殿しない場合は、溶媒留去、貧溶媒の添加あるいは冷却処理等により沈殿させることができる。

【0046】本発明においては、中性の多座配位子が配位したクロム錯体のうち、その多座配位子がfacialに配位したクロム錯体を用いることが好ましい。多座配位子がfacialに配位したクロム錯体を用いることにより、ボリエチレンの副生が抑えられる等の効果が認められる。ここで、多座配位子がfacialに配位した錯体は、配位子が3つ配位した6配位八面体型錯体の異性体の一つである[化学選書 有機金属化学一基礎と応用ー、143頁(裳華房])。即ち、配位子が3つ配位した6配位八面体型錯体において、3つの配位子はすべてシス位になるような配置で配位していることを意味する。

【0047】本発明において使用されるアルキル金属化 合物は、特に限定されるものではないが、例えば、下記 一般式(2)

 $R_{p}MX_{q}$ (2)

(式中、pは0 < p ≤ 3であり、qは0 ≤ q < 3であって、しかもp+qは1~3である。Mはリチウム、マグネシウム、亜鉛、ボロン又はアルミニウムを表し、Rは炭素数1~10のアルキル基からなる群より選ばれる1種以上を表し、Xは水素原子、アルコキシ基、アリール基及びハロゲン原子からなる群より選ばれる1種以上を表す)で示される化合物が好適なものとして挙げられる。

【0048】上記一般式(2)において、炭素数1~1 0のアルキル基としては、特に限定されるものではないが、例えば、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、シクロヘキシル基又はオクチル基等が挙げられる。アルコキシ基としては、特に限定されるものではないが、例えば、メトキシ基、エトキシ基、ブトキシ基又はフェノキシ基等が挙げられる。アリール基としては、特に限定されるものではないが、例えば、フェニル基等が挙げられる。ハロゲン原子としては、特に限定されるものではないが、例えば、フッ素、塩素、臭素又はヨウ素が挙げられる。 【0049】なお、上記一般式(2) において、MがA 1で、pとqがそれぞれ1.5のとき、A1 $R_{1.5}$ $X_{1.5}$ となる。このような化合物は、理論的には存在しないが、通常、慣用的にA1 $_2$ R_3 X_3 のセスキ体として表現されており、これらの化合物も本発明に含まれる。

【0050】上記一般式(2)で示されるアルキル金属 化合物としては、例えば、メチルリチウム、エチルリチ ウム、プロピルリチウム、n-ブチルリチウム、s-ブ チルリチウム、セーブチルリチウム、ジエチルマグネシ ウム、エチルブチルマグネシウム、エチルクロロマグネ シウム、エチルブロモマグネシウム、ジメチル亜鉛、ジ エチル亜鉛、ジブチル亜鉛、トリメチルボラン、トリエ チルボラン、トリメチルアルミニウム、トリエチルアル ミニウム、トリイソブチルアルミニウム、トリーnーへ キシルアルミニウム、トリーnーオクチルアルミニウ ム、トリシクロヘキシルアルミニウム、ジメチルエチル アルミニウム、ジエチルアルミニウムヒドリド、ジイソ ブチルアルミニウムヒドリド、ジエチルアルミニウムエ トキシド、ジエチルアルミニウムフェノキシド、ジシク ロヘキシルフェニルアルミニウム、エチルアルミニウム エトキシクロリド、ジエチルアルミニウムクロリド、ジ エチルアルミニウムブロミド、ジイソブチルアルミニウ ムクロリド、ジシクロヘキシルアルミニウムクロリド、 メチルアルミニウムセスキクロリド、エチルアルミニウ ムセスキクロリド、ブチルアルミニウムセスキクロリ ド、エチルアルミニウムジクロリド、イソブチルアルミ ニウムジクロリド等が挙げられる。

【0051】これらのうち入手の容易さ及び活性の面から、アルキルアルミニウム化合物が好ましく用いられ、さらに好ましくはトリエチルアルミニウム又はトリイソブチルアルミニウムが用いられる。これらのアルキル金属化合物は単独で使用し得るのみならず、二種以上を混合して用いることも可能である。

【0052】アルキル金属化合物の使用量は、クロム錯体1モルに対して0.1~10000当量であり、好ましくは3~3000当量、より好ましくは5~2000当量である。

【0053】本発明の中性の多座配位子が配位したクロム錯体、アルキル金属化合物及び変性粘土化合物からなるエチレンの三量化触媒は、前記のクロム錯体、アルキル金属化合物及び変性粘土化合物を原料に、溶媒中で接触させることにより調製できる。接触方法は特に制限されない。

【0054】この触媒を調製する際のクロム錯体の濃度は特に制限されないが、通常、溶媒11あたり0.00 1マイクロモル~100ミリモル、好ましくは0.01 マイクロモル~10ミリモルの濃度で使用される。これより小さい触媒濃度では十分な活性が得られず、逆にこれより大きい触媒濃度では、触媒活性が増加せず経済的でない。また、ここで用いられる溶媒としては、例え ば、ブタン、ペンタン、ヘキサン、ヘプタン、オクタン、イソオクタン、ノナン、デカン、シクロペンタン、シクロヘキサン、メチルシクロヘキサン、シクロオクタン、デカリン等の脂肪族炭化水素類、ベンゼン、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、クメン、トリメチルベンゼン、クロロベンゼン等の芳香族炭化水素類及び塩化メチレン、クロロホルム、四塩化炭素、ジクロロエタン等の塩素化炭化水素類が挙げられる。また、反応生成物、即ち、1ーヘキセンを溶媒として用いることもできる。これらの溶媒は、それぞれ単独で使用し得るのみならず、二種以上を混合して用いることも可能である。ここで、エチレンの三量化反応時のクロム錯体濃度をコントロールする目的で、必要に応じて濃縮や希釈しても差し支えない。

【0055】また、前記のクロム錯体、アルキル金属化合物及び変性粘土化合物を接触させる際の温度は-100~250℃、好ましくは0~200℃である。接触時間は特に制限されず、1分~24時間、好ましくは2分~12時間である。なお、接触時のすべての操作は、空気と水分を避けて行なうことが望ましい。また、原料及び溶媒は十分に乾燥しておくことが好ましい。

【0056】本発明のエチレンの三量化反応は、前記のクロム錯体、アルキル金属化合物及び変性粘土化合物からなる触媒とエチレンを接触させることにより行うことができる。接触方法は特に制限されないが、例えば、三量化反応原料であるエチレンの存在下に、クロム錯体、アルキル金属化合物及び変性粘土化合物を接触させて、接触と同時に三量化反応を開始する方法、又はクロム錯体、アルキル金属化合物及び変性粘土化合物を前もって接触させた後、エチレンと接触させて三量化反応を行う方法が採られる。

【0057】具体的には、前者の場合は、(1)クロム 錯体、アルキル金属化合物、変性粘土化合物及びエチレ ンをそれぞれ同時に独立に反応系に導入する、(2)ア ルキル金属化合物を含む溶液にクロム錯体、変性粘土化 合物及びエチレンを導入する、(3)クロム錯体、変性 粘土化合物を含む懸濁液にアルキル金属化合物及びエチ レンを導入する、(4)アルキル金属化合物及び変性粘 土化合物を含む懸濁液にクロム錯体及びエチレンを導入 する、(5)クロム錯体を含む溶液にアルキル金属化合 物、変性粘土化合物及びエチレンを導入する、という方 法により三量化反応を行うことができる。また、後者の 場合は、(1)クロム錯体及び変性粘土化合物を含む懸 濁液にアルキル金属化合物を導入する、(2)アルキル 金属化合物及び変性粘土化合物を含む懸濁液にクロム錯 体を導入する、(3)アルキル金属化合物を含む溶液に クロム錯体及び変性粘土化合物を導入する、(4)クロ ム錯体を含む溶液に変性粘土化合物とアルキル金属化合 物を導入する、という方法により触媒を調製し、エチレ ンと接触させて三量化反応を行うことができる。なお、

これらの原料の混合順序は特に制限されない。

【0058】本発明においては、必要に応じて、中性の 多座配位子が配位したクロム錯体、アルキル金属化合物 及び変性粘土化合物からなる触媒に光を照射し、エチレンの三量化反応を行ってもよい。光の照射により触媒活 性が大幅に向上する等の効果が認められる。

【0059】本発明において使用される光は、特に限定されるものではないが、例えば、紫外光、可視光、赤外光が挙げられ、発光波長としては、0.2~2000 nmの光が好ましく、より好ましくは200~700 nmの光が用いられる。また、光の照度は特に制限されない

【0060】光の光源としては、太陽光又は人工光源のいずれを用いてもよいが、太陽光は照度が小さく、天候に影響され、夜間の使用ができないことから、人工光源が望ましい。人工光源としては、特に限定されるものではないが、例えば、重水素ランプ、キセノンランプ、タングステンランプ、白熱電球、ハロゲンランプ、低圧水銀ランプ、ホローカソードランプ、金属蒸気放電管、メタルハライドランプ、高圧ナトリウムランプ、タリウムランプ、水銀ータリウムランプ、水銀ー鉛ランプ、円型放電管、キセノンー水銀ランプ、高圧水銀ランプ、超高圧水銀ランプ、フラッシュランプ等が挙げられる。

【0061】光の照射時期は、特に制限されるものではないが、前記のクロム錯体、アルキル金属化合物及び変性粘土化合物からなる触媒に照射してもよいし、またエチレンの三量化反応系に直接照射してもよい。なお、光の照射時間は特に制限されない。

【0062】本発明におけるエチレンの三量化反応の温度は、-100~250℃であるが、好ましくは0~200℃である。反応圧力は、反応系がエチレン雰囲気であれば特に削限されないが、通常、絶対圧で0.01~3000kg/cm²であり、好ましくは0.1~300kg/cm²である。また、反応時間は温度や圧力に左右され、一概に決めることはできないが、通常、5秒~6時間である。また、エチレンは、前記の圧力を保つように連続的に供給してもよいし、反応開始時に前記圧力で封入して反応させてもよい。原料ガスであるエチレンには、反応に不活性なガス、例えば、窒素、アルゴン、ヘリウム等が含まれていても何ら差し支えない。なお、エチレンの三量化反応のすべての操作は、空気と水分を避けて行うことが望ましい。また、エチレンは十分に乾燥しておくことが好ましい。

【0063】本反応は、回分式、半回分式、連続式のいずれでも実施できる。エチレンの三量化反応終了後、反応液に、例えば、水、アルコール、水酸化ナトリウム水溶液等の重合失活剤を添加して反応を停止させる。失活した廃クロム触媒は、公知の脱灰処理方法、例えば、水又はアルカリ水溶液による抽出等で除去した後、生成した1-ヘキセンは、公知の抽出法や蒸留法により反応液

より分離される。また、副生するポリエチレンは、反応 液出口で公知の遠心分離法や1-ヘキセンの蒸留分離の 際の残渣として分離除去される。

[0064]

【実施例】以下に、本発明を実施例を用いてさらに詳細 に説明するが、これらの実施例は本発明の概要を示すも ので、本発明はこれらの実施例に限定されるものではな い。

【0065】参考例1

シュレンク管で、J. Amer. Chem. Soc., 92,5118 (1970) に記載の方法で合成した三脚型構造を有するトリス (3,5-ジメチルー1ーピラゾリル)メタン 238mg、クロムへキサカルボニル176mg、メシチレン40ml及びトルエン10mlを混合し、窒素雰囲気下で1時間攪拌しながら加熱還流した。析出した結晶をろ過し、トリス (3,5-ジメチルー1ーピラゾリル)メタンクロムトリカルボニル

(0) (以下、錯体Aと称する)を得た。この錯体AのIR分析を行った結果、CO吸収に基づく2本のピークが1896cm⁻¹と1759cm⁻¹に認められ、トリス(3,5-ジメチル-1-ピラゾリル)メタンがクロムにfacialで配位していることを示した。

【0066】参考例2

ジメチルアニリン塩酸塩6.3g(40mmo1)を50mlの水に溶解し、この水溶液をヘクトライト[商品名:ラボナイトRD、日本シリカ工業(株)製]20gが入った水150mlに加えた。この懸濁液を室温で24時間攪拌し、上澄液を除去した後、水及びエタノールで洗浄した。その後、室温、10-5Torrで24時間乾燥し、変性粘土化合物(以下、変性粘土Bと称する)を得た。

【0067】実施例1

温度計及び攪拌装置を備えた内容積150m1のガラス製耐圧反応容器に、参考例1で合成した錯体Aを6.9mg、0.154mo1/1のトリイソブチルアルミニウム/シクロヘキサン溶液2.1m1及び参考例2で合成した変性粘土B0.20gと乾燥したトルエン80m1を入れ、混合撹拌した。

【0068】反応容器を80℃に加熱し、撹拌速度を1400rpmに調整後、反応容器にエチレンを導入して、さらにウシオ電気製超高圧水銀ランプ(500W)を用い、外部から光を照射して、エチレンの三量化反応を開始した。反応容器内の絶対圧力を5kg/cm²となるようにエチレンガスを吹き込み、以後、前記圧力を維持するように導入し続け、これらの反応条件を保った状態で30分反応を行なった。30分後、反応容器中に水を窒素で圧入することによって触媒を失活させて反応を停止した。

【0069】反応容器を室温まで冷却し、次いで脱圧した。反応液及び回収した気体中に含まれる生成物をガス

クロマトグラフィーにより分析した。また、反応液に含まれる固体分をろ紙を用いてろ別し、これを風乾後、減圧下で乾燥(1Torr、100℃)して、その重量を測定した。さらに、この乾燥固体を電気炉で700℃で焼成して、その強熱残分を測定し、乾燥固体から強熱残分を減じた重量をポリマー重量とした。結果を表1に示す。

【0070】実施例2

シュレンク管に、変性粘土B0.20g、0.154m o1/1のトリイソブチルアルミニウム/シクロヘキサン溶液2.1ml及び乾燥したトルエン40mlを入れ、混合攪拌し、懸濁液を得た(以下、懸濁液Cと称する)。

【0071】温度計及び攪拌装置を備えた内容積150mlのガラス製耐圧反応容器に、参考例1で合成した錯体Aを6.9mg、0.154mol/1のトリイソブチルアルミニウム/シクロヘキサン溶液2.1mlと乾燥したトルエン40mlを入れ、混合撹拌した。ウシオ電気製超高圧水銀ランプ(500W)を用い、外部から光を30分間照射した後、上記懸濁液Cを混合した。

【0072】反応容器を80℃に加熱し、撹拌速度を1

400 r p mに調整後、反応容器にエチレンを導入して、エチレンの三量化反応を開始した。反応容器内の絶対圧力を5 k g / c m²となるようにエチレンガスを吹き込み、以後、前記圧力を維持するように導入し続け、これらの反応条件を保った状態で30分反応を行なった。30分後、反応容器中に水を窒素で圧入することによって触媒を失活させて反応を停止した。

【0073】反応容器を室温まで冷却し、次いで脱圧した。反応液及び回収した気体中に含まれる生成物をガスクロマトグラフィーにより分析した。また、反応液に含まれる固体分をろ紙を用いてろ別し、これを風乾後、減圧下で乾燥(1Torr、100℃)して、その重量を測定した。さらに、この乾燥固体を電気炉で700℃で焼成して、その強熱残分を測定し、乾燥固体から強熱残分を減じた重量をポリマー重量とした。結果を表1に示す。

【0074】比較例1

変性粘土Bを用いなかったこと以外、実施例1と同様に して反応を行なった。結果を表1に示す。

【0075】

【表1】

	-	突施例 1	実施例 2	比較例1
触媒				
Cr錯体		錯体A	蜡体 A	蜡体A
	µmo l	16.0	16.0	16.0
アルキル金属化合物		i - BusAi	i - BusAl	1-8u:A1
	µmo i	320	640	240
変性粘土化合物		変性粘土B	变性粘上B	
	mg	100	200	_
溶媒		トルエン	トルエン	トルエン
反応条件				
反応温度	* C	8.0	8.0	1 80
反応圧力	kg∕cm³	5	5	5
反応時間	_ / }	3 0	30	30
結果				
触媒活性 g 1-ヘキセン/g-Cr・間		746	1840	445
液体	wt%	81.1	N	
固体 (PE)	wt%	18.9	95. 5 4. 5	99.0
液体中の	wt%	1 0. 9	4. 5	1. 0
生成物分布	C4	2.6		
工程(2017)110	C6	91.0	2. 8 90. 2	4.4
	C8 i			77.9
		•	1. 1	2. 3
	C10	1.9	2. 5	5.6
	C12+	2.3	3. 9	9.8
C 6 純度	w t %	99.0	99.0	96.2

(注) C4: 7 デン、C6: ヘキセン、C8: オクテン、C10:デ セン、C12+; ド デ セン以上の確保オンフィン、 PE; ボ リエチレン、

C磁度=(1-ヘキセン/全ヘキセン)X100

[0076]

【発明の効果】本発明によれば、中性の多座配位子が配位したクロム錯体、アルキル金属化合物及び変性粘土化

合物の少なくとも3成分からなるエチレンの三量化触媒を用いることにより、エチレンから効率よく、かつ高選択的に1-ヘキセンを製造することができる。

フロントページの続き

Fターム(参考) 4J028 AA01A AB00A AC42A BA00A

BA01B BB00A BB00B BB01B BC01B BC05B BC06B BC07B BC09B BC12B BC13B BC15B BC16B BC17B BC18B BC19B BC24B BC27B CA30C CB61C

CB81C CB87C EB02 GA01

GA26 GB01